〈研究発表〉

オゾン発生装置の分光によるガス温度測定とオゾン発生特性

村田 隆昭,雨森 清行,中嶋 可南子,久保 貴恵

株式会社 東芝 (〒183-8511 東京都府中市東芝町 1, E-mail: takaaki.murata@toshiba.co.jp)

概要

オゾン発生装置で用いられる誘電体バリア放電におけるマイクロ放電の局所的短時間的なガス温度上昇を考慮する必要がある。そこで、分光によりガス温度の測定を行った。その結果、およそ 100K のガス温度上昇が認められた。このガス温度上昇について温度拡散モデルによりガス 温度の緩和時間を求めたところ、放電により生成する O から O3 への変換にはこのガス温度上昇 を考慮する必要があることがわかった。本論文ではこのようなガス温度上昇を考慮したモデルに おけるオゾン発生特性についても議論する。

キーワード:オゾン,プラズマ,誘電体バリア放電,分光,モデル

1. はじめに

高度浄水処理に用いられるオゾン発生装置は Fig. 1 に示すように金属管内部にガラス管を挿入し、ガラス 管内部に設けた金属膜に高電圧を印加することで金属 管とガラス管の間にできる空隙に酸素ガスあるいは乾 燥空気を流して放電させることでオゾンを発生する。 このような放電は誘電体バリア放電と呼ばれたり、あ るいは無声放電とも呼ばれる。

オゾン発生装置ではオゾンが放電による熱で分解し やすいため、金属管を冷却水によって冷却している。 放電管は通常、断熱状態にあるため、ガス温度上昇の 定常解/Ts は従来、次式によって求められてきた。

$$\Delta T_{S} = \frac{W/S}{3\kappa}d\tag{1}$$

ここで W は投入電力、S は放電面積、K は熱伝導率、 d は放電ギャップである。

ところで誘電体バリア放電は、Fig. 2 に示すマイク ロ放電と呼ばれる直径数 100µm 程度のフィラメント 状放電の集合体であるため、ガス温度上昇について次 のような議論がなされてきた。マイクロ放電は放電開 始後、電子が誘電体をチャージアップして逆電圧を発



Fig. 1 Structure of Ozone Generator

生し、自動的に放電停止する。その放電持続時間は数 10nsと大変短い。そのため、ガス温度は熱伝導で定常 的にならず、マイクロ放電空間に熱が入り温度上昇す ることになる。このようなマイクロ放電の局所的、短 時間的なガス温度上昇∠Tc は

$$\Delta T_C = \frac{u}{\rho C_p} \tag{2}$$

で与えられる。ここで u はマイクロ放電の体積あたり のエネルギー密度、 ρ はガス密度、Cp はガスの比熱で ある。この \triangle Tc については、Eliasson らによると \triangle Tc<11K であるとされる報告 1)と、Pietsch らによる と \triangle Tc<40-100K とする報告 2)がある。

先にも述べたが、ガス温度上昇はオゾン分解に影響 するため、その見積もりが非常に重要となる。今回、 ガス温度上昇をガス中に含まれる窒素のセカンド・ポ ジティブ・バンドの発光から測定した。また、ガス温 度の緩和をシミュレーションにより求め、このガス温 度上昇の時間を見積もった。また、このような短時間 的なガス温度上昇△Tc を考慮したオゾン発生過程を 化学反応の速度方程式を解くことで得た結果について も新たに得られた知見を述べる。



Fig. 2 High Speed Camera Image of Microdischarges

2. 実験方法

Fig. 3 に実験装置の構成を示す。マイクロ放電の像 をレンズによってファイバ上に結像し、分光器により 分光する。分光結果はパソコンにとりこみ、以下の方 法でカーブ・フィッティングすることでガス温度を求 めた。

プラズマ中の窒素の発光を分光計測することで窒素 の振動温度及び回転温度を求めることが出来る。ここ で回転温度は大気圧などの衝突が盛んなプラズマ中で は中性分子の並進温度、すなわちプラズマのガス温度 の近似値を与えると考えられている。ここでは窒素の Second Positive System Line を分光器によって観測 し、得られたスペクトルと数値計算によって得られる スペクトルをフィッティングさせることで振動温度及 び回転温度を決定する。以下にスペクトルの計算方法 を述べる。理論線の波長λは(3)式となる。

$$\lambda_{Bv'J''}^{Cv'J''} = \left\{ n_a \sum_{p=0}^{5} \sum_{q=0}^{2} Y_{pq}^c (v' + \frac{1}{2})^p [J'(J' + 1)]^q - Y_{pq}^B (v'' + \frac{1}{2})^p [J''(J'' + 1)]^q \right\}^{-1} (3)$$
次に求めた各々の波長の強度を以下の式から求める。

$$I_{J''}^{J''} = \frac{K}{\lambda^4} q_{\nu'\nu''} \exp(-\frac{E_{\nu'}}{K_B T_{\nu}}) S_{J'J''} \exp(-\frac{E_{J'}}{K_B T_{r}}) \quad (4)$$

$$E_{J'} = hc \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{q=1}^{\infty} Y_{pq}^{c} (\nu' + \frac{1}{2})^{p} [J'(J'+1)]^{q}$$
(5)

$$Ev' = hc \sum_{p=1}^{5} Y_{p0} (v' + \frac{1}{2})^{p}$$
(6)

ここでhはプランク定数、cは光速、KBはボルツマ ン定数、qvvでは Franck-Condon 因子、SJJT は Honl-London 因子、Tv及びTr はそれぞれ振動温度、 回転温度である。得られた各々の遷移の発光のプロフ ァイルをガウス型と仮定し、すべての遷移についてフ ィッティングを行いそれらを合成することでスペクト ルが得られる。分光器による観測によって得られたス ペクトルに上記のように計算で得られたスペクトルを フィッティングさせることで温度の決定ができる。 Fig.4 には典型的な分光器出力とフィッティングした 計算結果をあわせて示した。フィッティングは最小値 2乗法により行い、回転温度が自動的に求めることが



Fig. 3 Experimental Set-up

できるように工夫した。実験では酸素/窒素 (80%/20%)の混合ガスを用いて圧力 0.2 MPa の条件 で印加電圧を 12kVop に固定して周波数を変えて放電 電力密度を 2,4,6kW/m² に調整して放電発光を分光器 で観測した。



Fig. 4 Spectrum of N2 Second Positive Band

3. 結果および検討

Fig.5 に各放電ギャップ長での回転温度の放電電力 密度依存を示す。(a)は放電ギャップ長=0.2mm、(b) は放電ギャップ長=0.6mm、(c)は放電ギャップ長 =1.0mmの結果である。いずれも、ベースの上昇分に 加えて電力密度に比例する成分がある。

電力密度に比例する成分は(1)式の△Ts に対応している。放電ギャップ長依存性として(1)式は放電ギャップ 長dに比例していることから、放電ギャップ長dが大きいほど傾きが大きいことからも、ベースの上昇分は △Tc に対応するものと考えられる。

$$T = WT + \Delta Ts + \Delta Tc$$

ここで WT は冷却水温である。

(7)

ガス温度はいずれも 400K 程度となり、ガス温度上 昇は 100K 程度である。ガス温度上昇の測定値として は Pietsch らによる ∠ Tc<40-100K とする報告 ²⁰に近 い値が得られ、その値はオゾンの熱分解に影響する大 きさであることがわかった。

そこで、ガス温度の上昇~拡散過程は(8)式の熱伝導 の基礎方程式を解き、温度の時間変化をオゾン生成反 応時間と比較することで考察を行うことにした。

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{\rho C_p} \nabla^2 T + \frac{u}{\rho C_p}$$
(8)

ここで、T[K]は温度、t[s]は時間である。



Fig. 5 Rotational Temperature Measured with Spectra of N2 Second Positive Band

ガス温度の上昇と緩和について2次元計算した結果 を Fig. 6 に示す。図中 X 軸は放電ギャップで X=0mm ではガラス(断熱側)があり、X=0.3mm に金属電極(冷 却側)がある。Y 軸は電極の横方向を示す。図より数 10μs で温度が緩和していくことがわかる。マイクロ放 電が点弧した時間は 10ns としており、マイクロ放電 に対応した空間にガス温度上昇が認められる。その後、 温度のピーク値は下がり、横方向に拡散していく。 50μs 後にはほぼ全体に温度が拡散していく。



Fig. 6 Gas Temperature Relaxation after Microdischarge

その後、温度のピーク値は下がり、横方向に拡散し ていく。50µs後にはほぼ全体に温度が拡散していく。 オゾン生成の基本的な化学反応は酸素原料オゾン発 生装置の場合、(R1)~(R4)の反応で表される。その反 応は酸素分子の解離、オゾンの生成、オゾンの分解反 応が進む。(R3)の反応は温度依存が大きいため、ガス 温度上昇が分解に大きく影響する。

e+O2→e+O+O	(R1)
O+O2+O2→O3+O2	(R2)
0+03→02+02	(R3)
e+O3→e+O+O2	(R4)
これらの化学反応についての速度方程式をか	- てろり

次式となる。

$$\begin{split} d[O]/dt &= 2*k1*[e]*[O2] - k2*[O]*[O2]*[O2] \\ &-k3*[O]*[O3] + k4*[e]*[O3] \quad (9) \\ d[O2]/dt &= -k1*[e]*[O2] - k2*[O]*[O2]*[O2] \\ &+ 2*k3*[O]*[O3] + k4*[e]*[O3] \quad (10) \\ d[O3]/dt &= k2*[O]*[O2]*[O2] - k3*[O]*[O3] \\ &-k4*[e]*[O3] \quad (11) \end{split}$$

ここで、[N]は数密度、kn (n=1~4) は速度定数で ある。

Fig.7 に上記反応の計算結果およびガス温度の計算 結果を示す。ここでガス温度はマイクロ放電の生成し た部分のガラスー金属電極間の平均ガス温度を示した。 マイクロ放電は最初の 10ns 程度で放電が誘電体のチ ャージアップによって自動的に停止し、ガス温度は上 昇する。本計算では振動準位の緩和過程等は考慮して いない。ガス種の数密度は O から O3 生成の時間が 0.5µs 程度であり、この間はガス温度がまだ高温を維 持していることがわかる。ガス温度が緩和するのは数 µs であることから、オゾン生成反応に寄与するガス温 度は∠Tc を考慮する必要がある。



Fig. 7 Chemical Reaction and Temperature Change in Microdischarge

Fig. 8に △Tc を考慮した場合と考慮しない場合のオゾ ン発生特性を示す。条件は放電ギャップ d=0.3mm、 ガス圧 P=0.21MPa、電力密度 W/S=3kW/m² である。 実線が(9)~(11)式を解いた計算結果であり、丸印が実 験結果である。⊿Tcを考慮した場合は計算結果と実験 結果がよい一致を示している。⊿Tcを考慮しない場合、 計算結果は実験結果から乖離してしまうことがわかっ た。

以上のようにガス温度上昇について温度拡散モデル によりガス温度の緩和時間を求めたところ、放電によ り生成する O から O3 への変換にはこのガス温度上昇 を考慮する必要があり、ガス温度上昇を考慮したモデ ルではオゾン発生特性をよく説明できることがわかっ た。



Fig. 8 Relationship between Efficiency and Ozone Concentration (Discharge Gap d=0.3mm, Gas Pressure P=0.21MPa, Power Density $W/S=3kW/m^2$)

4. 結論

以上述べたようにマイクロ放電中のガス温度上昇に ついて分光による解析と温度の緩和過程について研究 を行った結果、以下のことがわかった。

(1)マイクロ放電中のガス温度上昇は Pietasch らの示 したのと同様およそ 100K 程度である。

(2)マイクロ放電空間のガス温度はその後、定常状態に 緩和していく。その緩和時間は数µs 程度である。

(3) 放電により生成した O 原子から O3 への変換は 0.5µs 程度であり、反応を検討する上で必要なガス温 度は比熱に入る温度を考慮する必要がある。

参考文献

- B. Eliasson, M. Hirth, U. Kogelschatz, J. Phys. D: Appl. Phys., 20(1987)1421
- D. Braun, U. Kuchler, G. Pietsch, J. Phys. D: Appl. Phys., 24(1991), 564